

第47期定時株主総会



東京エレクトロン株式会社
2010年6月18日



私が目指す東京エレクトロン



私が目指す東京エレクトロン

- 半導体製造装置技術を礎として人々の豊かな生活と社会基盤の充実に貢献する会社
- その使命感を経営者と社員が共有し実現することで株主様を始め広く社会から評価されより誇りを持てる会社



大切にしていること

世界No.1の技術開発力

- 未開の地の開拓には貪欲に挑戦
- 必要なことには惜しみなく開発費を投入

お客様からの絶対的な信頼

- 誠実な姿勢は今後も最上位

社員が生き生きと躍動する会社

- フェアで透明性のある経営
- 個々の役割が実感できる組織



報告事項

- 第47期成果報告
- 第47期業績報告
- 第47期配当
- 第48期業績見通し
- 中期成長に向けて

第47期成果報告



第47期事業成果

中期的視点

- 技術開発
- お客様との関係強化
- 人材活性化

短期対応

- 市場急変への対応
 - 前年比300億円の固定費削減達成



第47期事業成果

中期的視点

● 技術開発

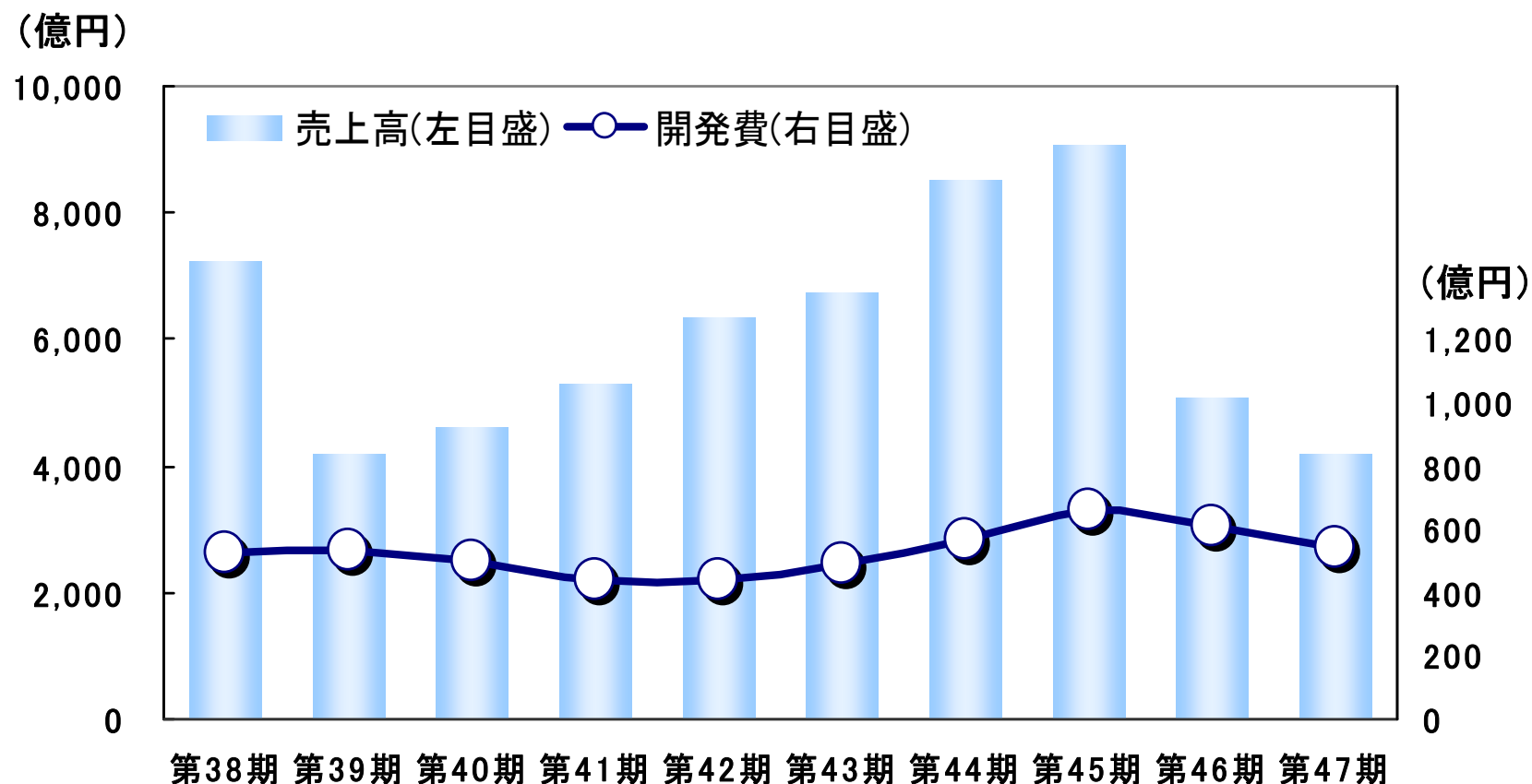
- 高水準な研究開発投資
- 宮城新工場（一貫工場）の着工決定

● お客様との関係強化

● 人材活性化

■ 第47期成果報告

売上高と研究開発費の推移



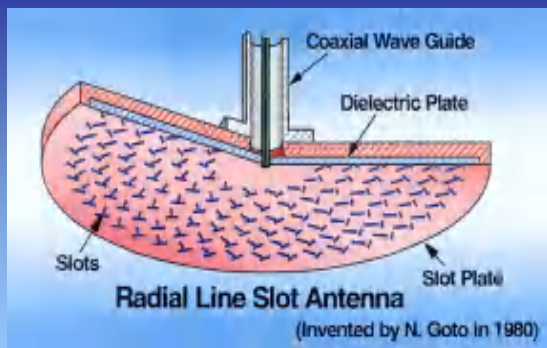
常に一定の研究開発費を維持



産学官連携による新たなプラズマ技術

平成十五年度 産学官連携功労者表彰

内閣総理大臣賞受賞



Radial Line Slot Antenna



Tactras® RLSA™ Etch

基礎技術

- 低ダメージ
- 高選択比

装置開発

量産装置化

- ポリエッチ
- CVD 等

新しい技術を製品として具現化



特許総合力

➤ 2010年米国特許ランキング

SEMICONDUCTOR EQUIPMENT MANUFACTURING										
RANK	COMPANY/ORGANIZATION, COUNTRY	2009 U.S. PATENTS	PIPELINE GROWTH INDEX	PIPELINE IMPACT	SELF-CITATIONS	ADJUSTED PIPELINE IMPACT	PIPELINE GENERALITY	PIPELINE ORIGINALITY	PIPELINE POWER	ADJUSTED PIPELINE POWER
1	Tokyo Electron Ltd., Japan	347	1.26	1.99	40.6%	1.78	1.90	0.54	886	792
2	KLA-Tencor Corp., U.S.	122	0.87	2.19	28.5%	2.19	2.20	1.05	536	536
3	Disco Corp., Japan	54	1.23	1.17	61.7%	0.80	2.02	3.00	472	322
4	FormFactor Inc., U.S.	40	1.25	5.00	10.9%	5.00	5.00	0.25	312	312
5	Applied Materials Inc., U.S.	339	1.12	1.94	56.2%	1.43	1.97	0.25	361	266
6	Teradyne Inc., U.S.	37	1.32	1.51	13.0%	1.51	1.78	1.49	196	196
7	Lam Research Corp., U.S.	94	1.27	0.89	31.0%	0.88	1.40	0.65	97	96
8	ASM International NV, Netherlands	72	1.36	2.04	31.0%	2.02	1.78	0.25	89	88
9	ASML Holding NV, Netherlands	262	0.79	1.22	50.2%	0.98	1.65	0.25	104	83
10	Novellus Systems Inc., U.S.	49	0.92	2.57	42.4%	2.25	2.39	0.25	70	61

出所: IEEE spectrum / January, 2010

半導体製造装置部門の総合評価で第1位



宮城新工場(大和町)完成予想図



開発・製造一貫体制により製品総合力を強化



第47期事業成果

中期的視点

● 技術開発

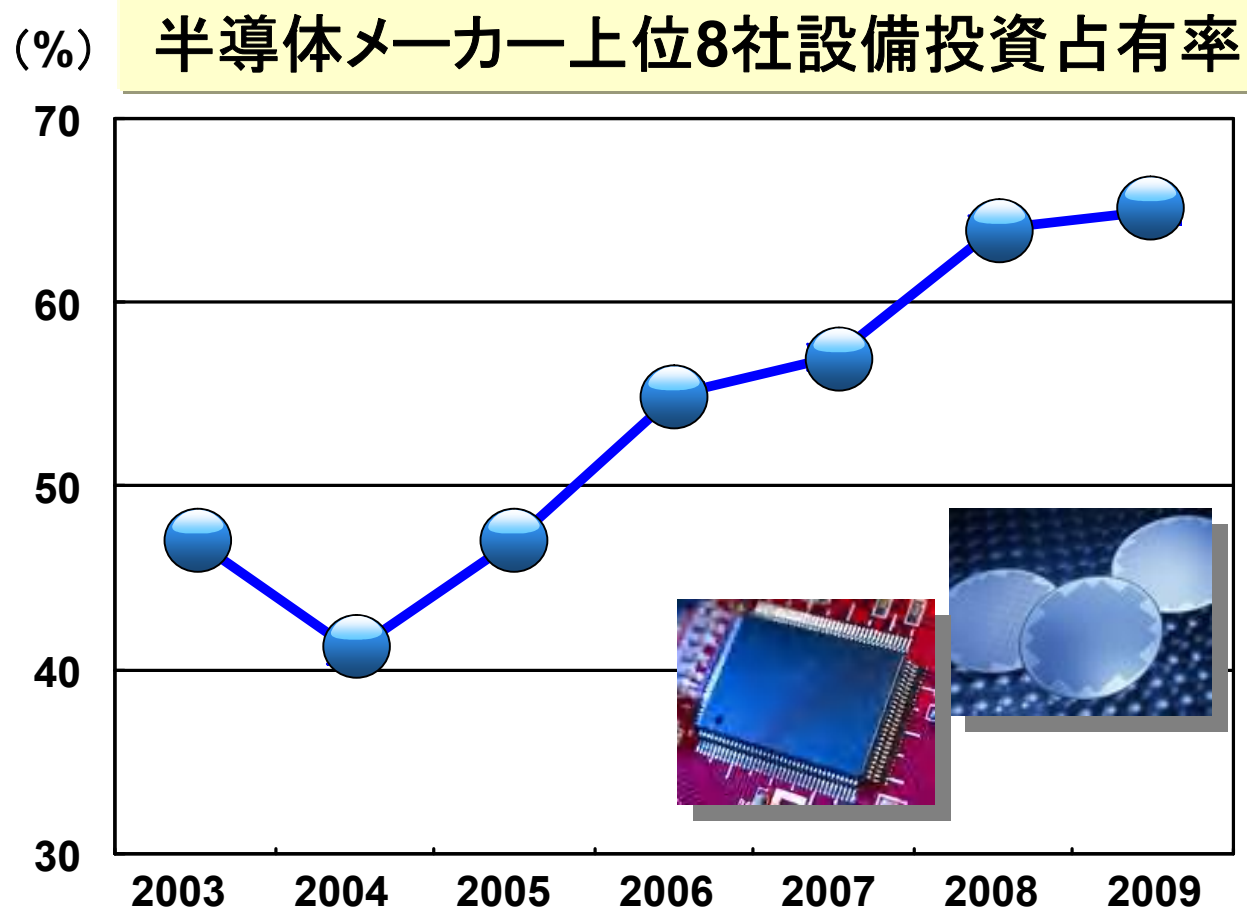
● お客様との関係強化

- 台湾・米国において開発拠点を新設、強化
- フィールドエンジニアリング事業の拡充

● 人材活性化



寡占化が進む半導体業界



出所: Gartner, 2010年3月 を基に当社作成



グローバル開発拠点



先端技術に密着した開発体制



フィールドエンジニアリングの強化



稼動装置 50,000台へのソリューション提供



第47期事業成果

中期的視点

● 技術開発

● お客様との関係強化

● 人材活性化

- 社員はTELの財産
- ワングレードアッププログラム

人材活性化 ＝ワン グレードアップ プログラム＝

基本コンセプト

- 人・組織の能力強化
- 『自ら学び、教え合う文化』の醸成



軽井沢研修センター

第47期事業成果

中期的視点

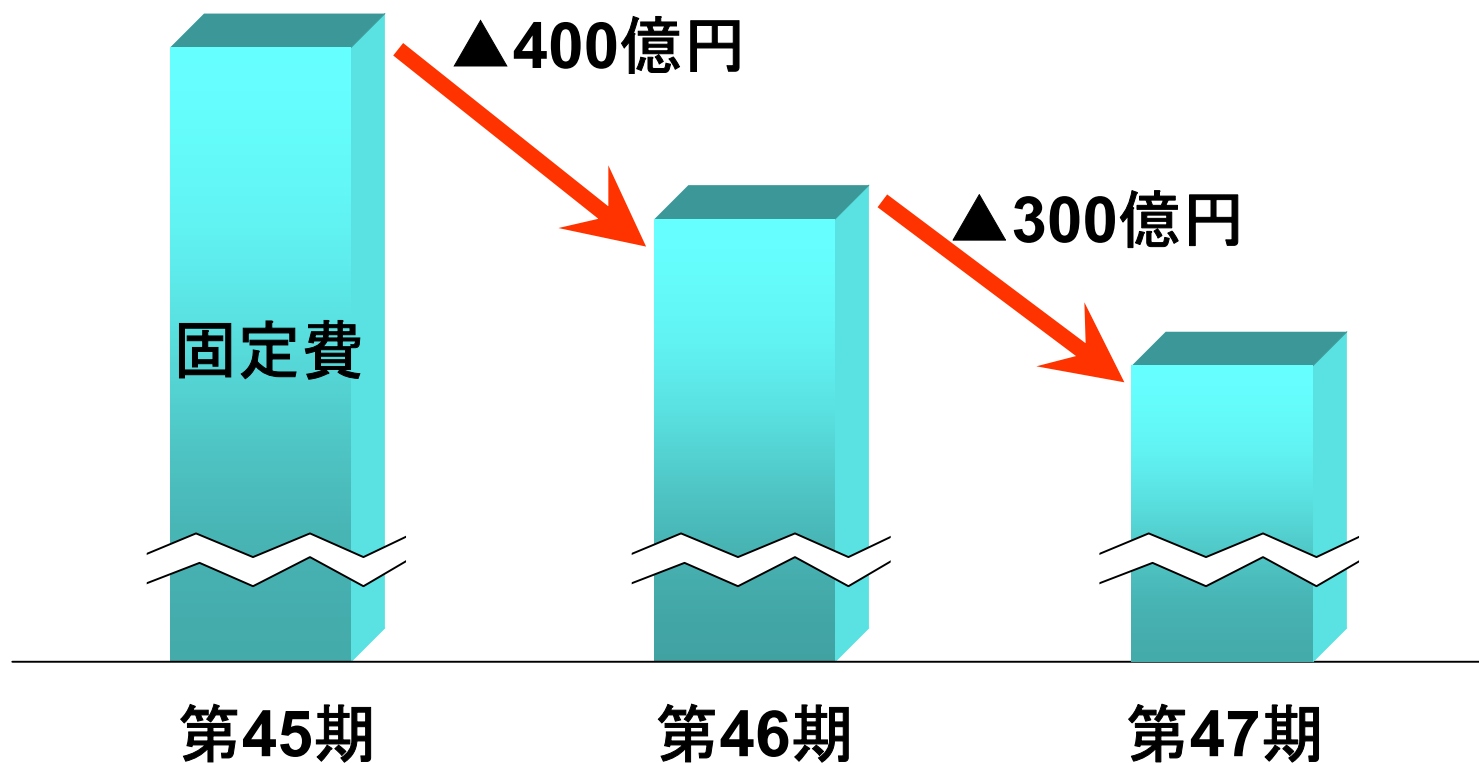
- 技術開発
- お客様との関係強化
- 人材活性化

短期対応

- 市場急変への対応
 - 前年比300億円の固定費削減達成



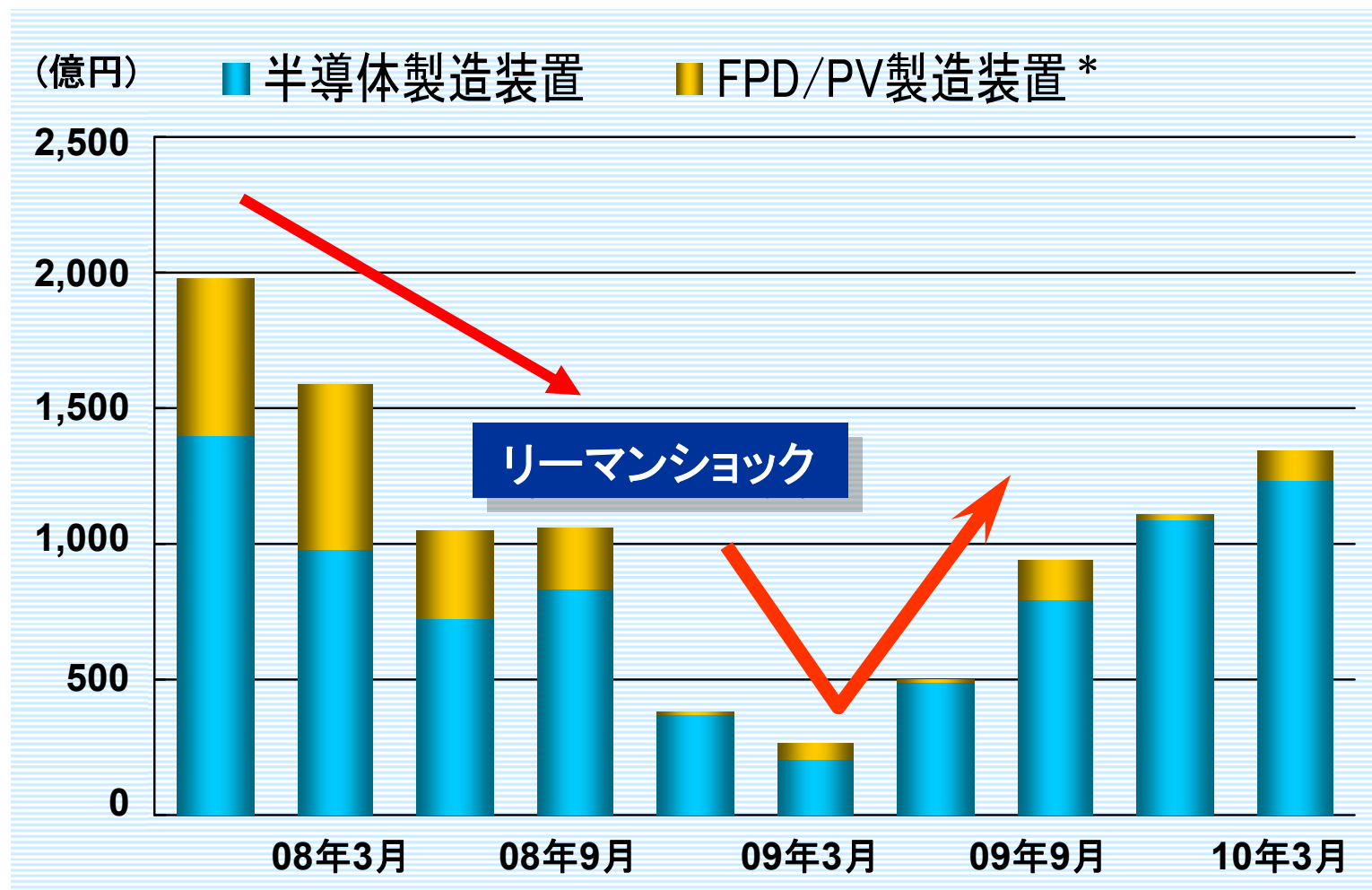
固定費削減の推移



前年度の400億円に続き 300億円の固定費削減



四半期受注額の推移

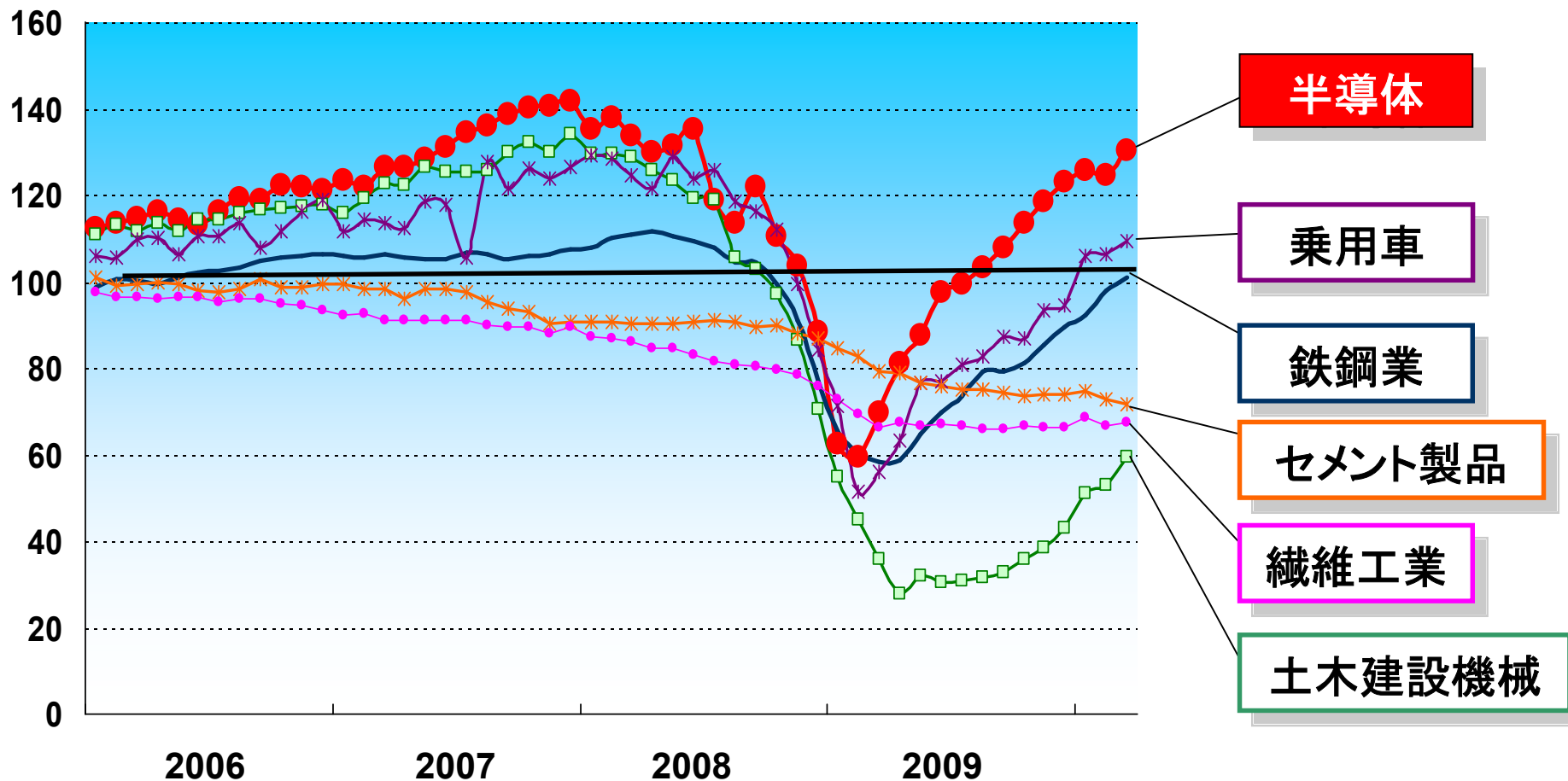


* フラットパネルディスプレイ及び太陽電池製造装置



V字回復した半導体産業

鉱工業生産指数



(注) 鉱工業生産指数=2005年の平均を100とした生産動向を表す指数 出所: 経済産業省



第47期業績報告



連結損益計算書

(億円)

	第46期	(%)	第47期	(%)	前期比	第47期 期初予想
売上高	5,080	100.0	4,186	100.0	-17.6%	3,000
営業利益	147	2.9	-21	-0.5	—	-630
経常利益	205	4.0	25	0.6	-87.6%	-610
税前利益	96	1.9	-77	-1.9	—	-610
当期純利益	75	1.5	-90	-2.2	—	-380



第47期 連結業績

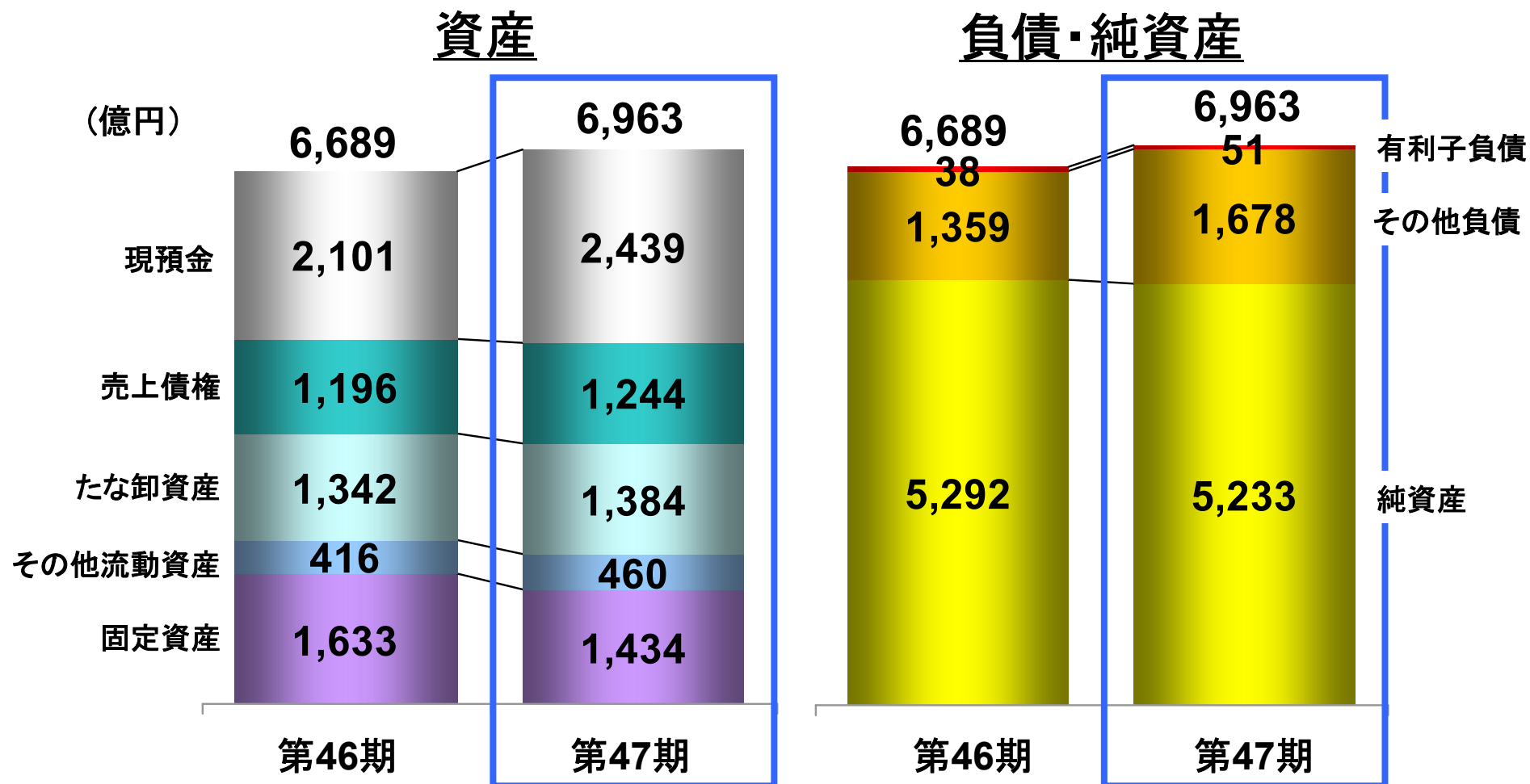
(億円)

	上期	(%)	下期	(%)	通期	(%)
売上高	1,538	100.0	2,647	100.0	4,186	100.0
営業利益	-216	-14.0	194	7.3	-21	-0.5
経常利益	-192	-12.5	217	8.2	25	0.6
税前利益	-262	-17.1	184	7.0	-77	-1.9
当期純利益	-161	-10.5	71	2.7	-90	-2.2



■ 第47期業績報告

連結貸借対照表



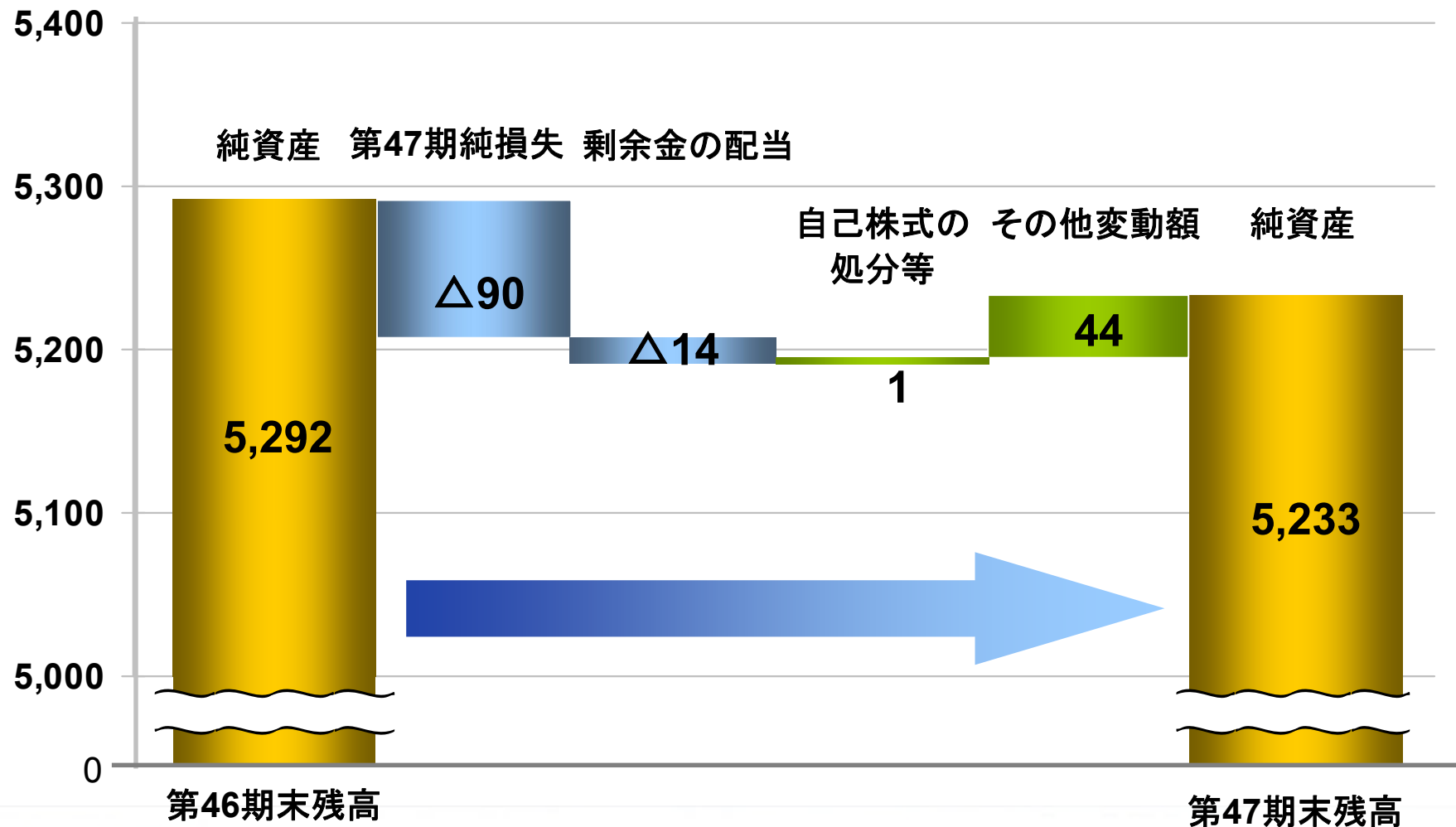
現預金： 現金及び預金と有価証券に含まれる譲渡性預金を加えたもの



■ 第47期業績報告

連結株主資本等変動計算書

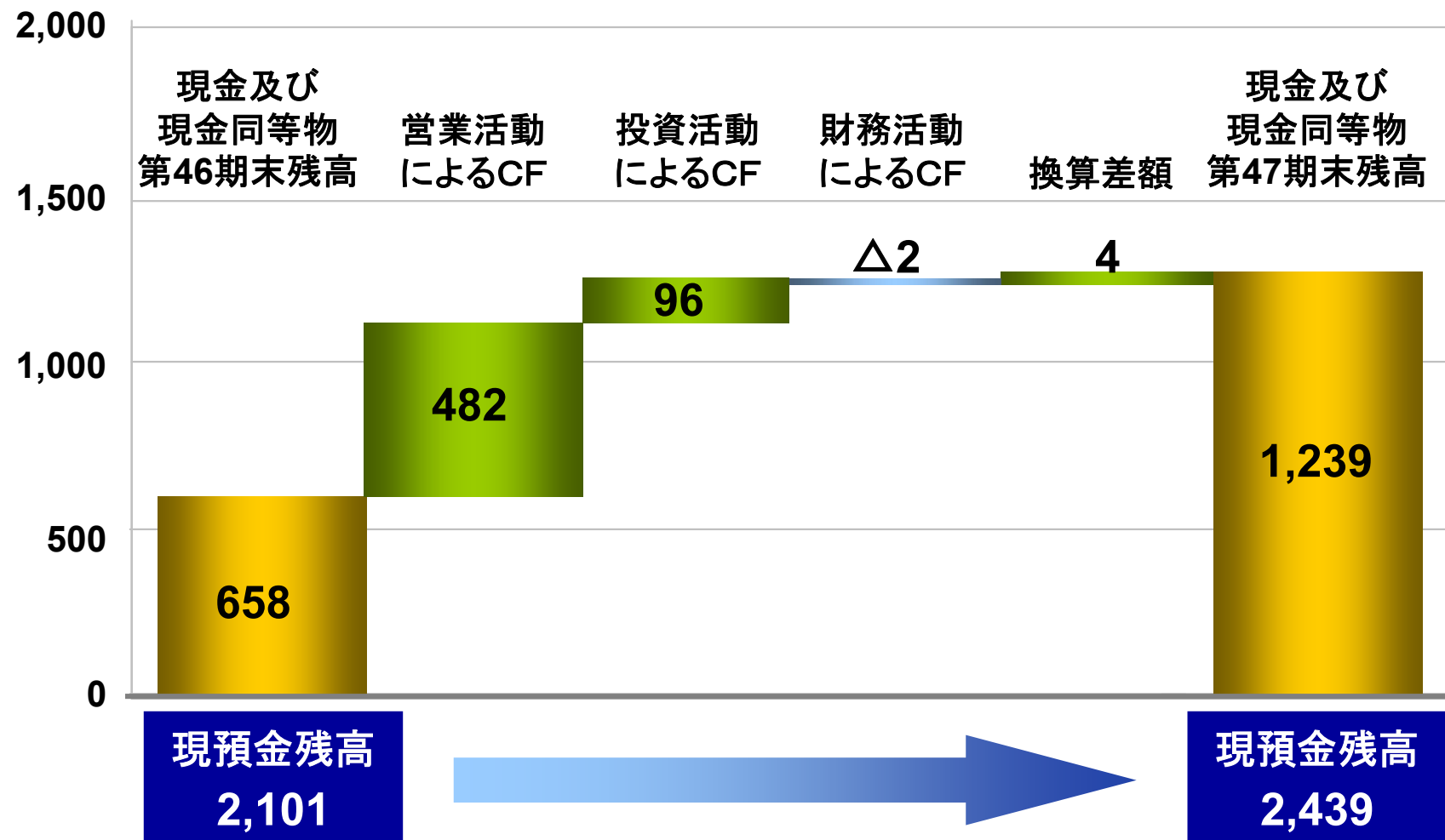
(億円)



■ 第47期業績報告

連結キャッシュ・フロー計算書

(億円)



現預金残高: 現金及び現金同等物に預入期間3ヶ月超の定期預金及び譲渡性預金を加えたもの



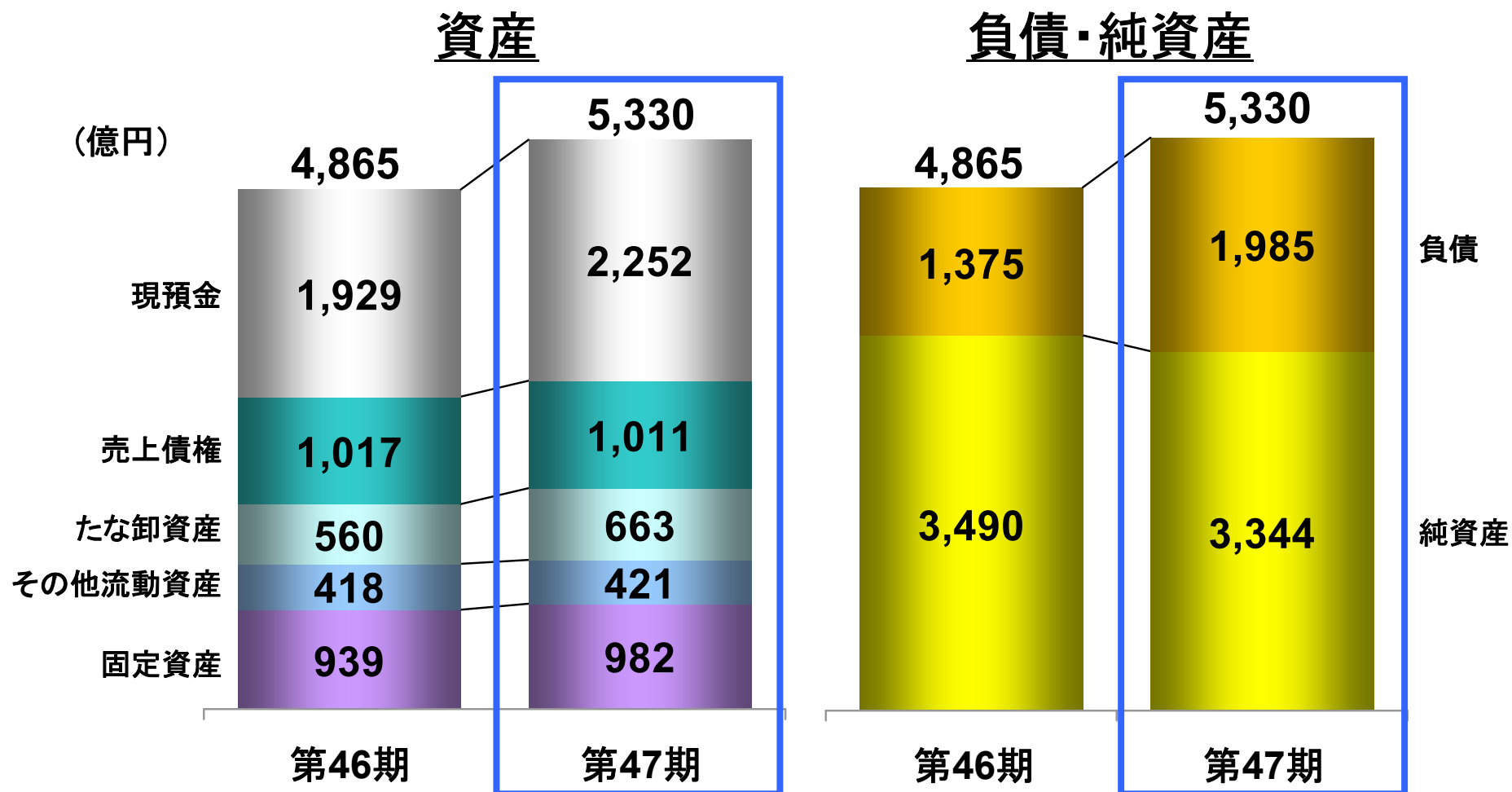
単独損益計算書

(億円)

	第46期	(%)	第47期	(%)	前期比
売上高	3,894	100.0	3,182	100.0	-18.3%
営業利益	84	2.2	-161	-5.1	—
経常利益	149	3.8	-139	-4.4	—
税前利益	62	1.6	-230	-7.3	—
当期純利益	99	2.5	-168	-5.3	—



単独貸借対照表



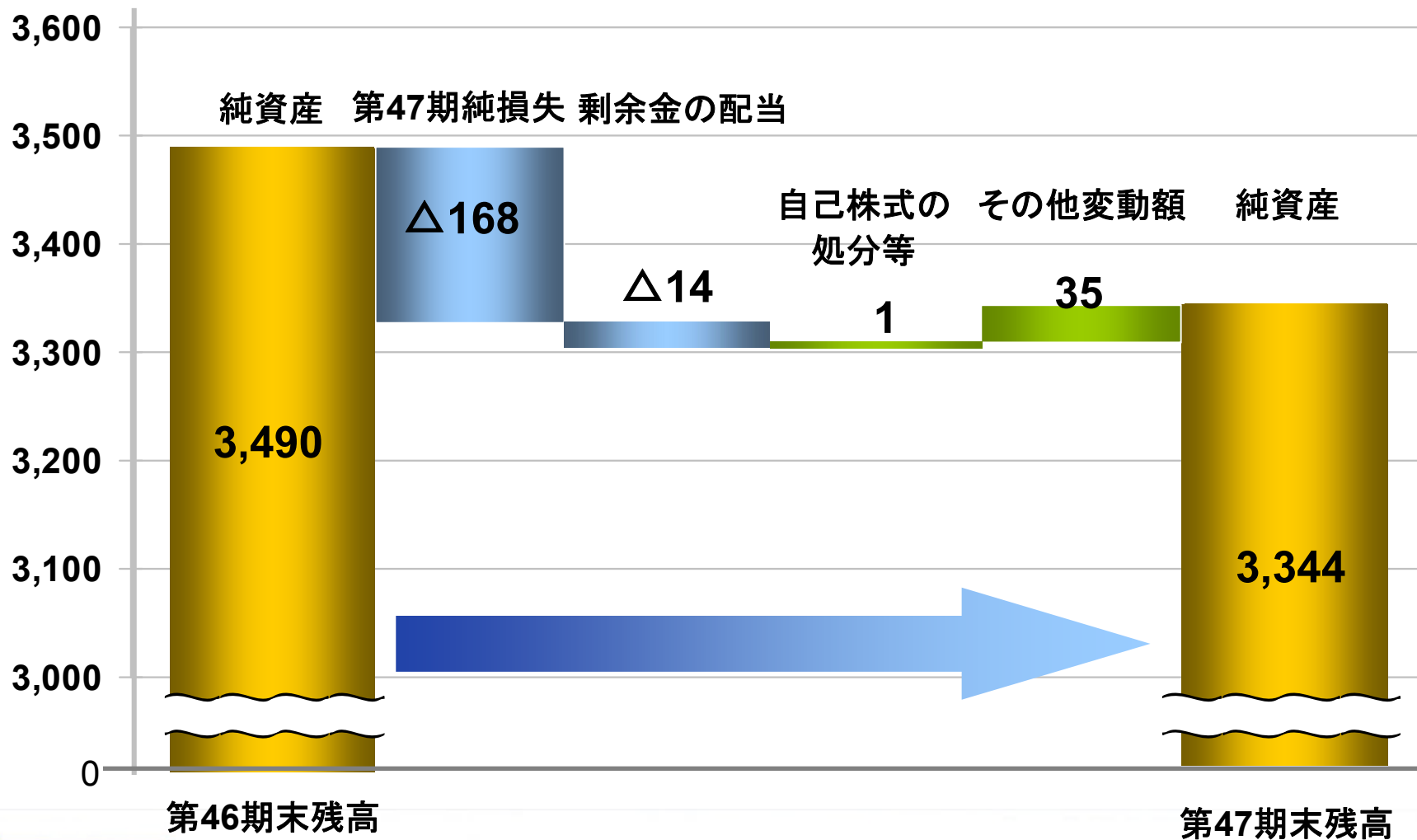
現預金： 現金及び預金と有価証券に含まれる譲渡性預金を加えたもの



■ 第47期業績報告

単独株主資本等変動計算書

(億円)



第47期配当



■ 第47期配当

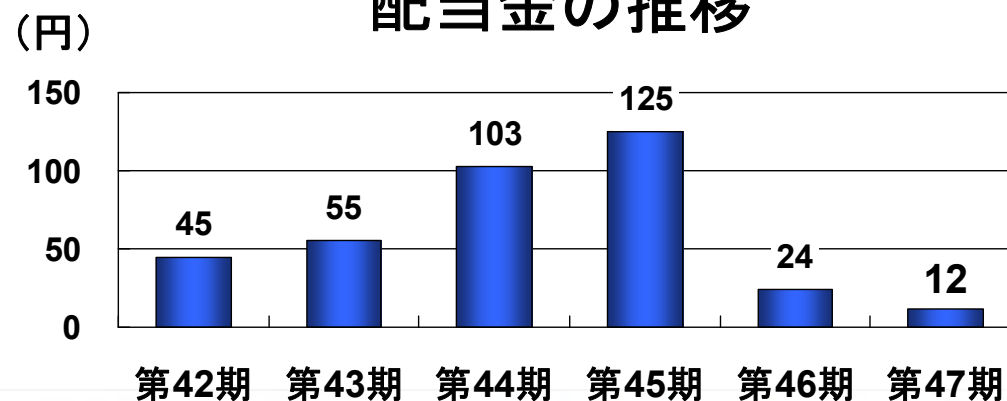
第47期の配当

1株当たり配当金

	中間	期末	年間
第47期	4 円	8 円	12 円

配当総額	連結 配当性向
21 億円	- %

配当金の推移



第48期業績見通し



第48期の製造装置事業環境

▶ 半導体

世界経済の回復に伴い、半導体需要が大幅に伸張
前工程投資は前期比90%以上の増加を予想

▶ フラットパネルディスプレイ

中国を中心として薄型TV需要は引き続き旺盛

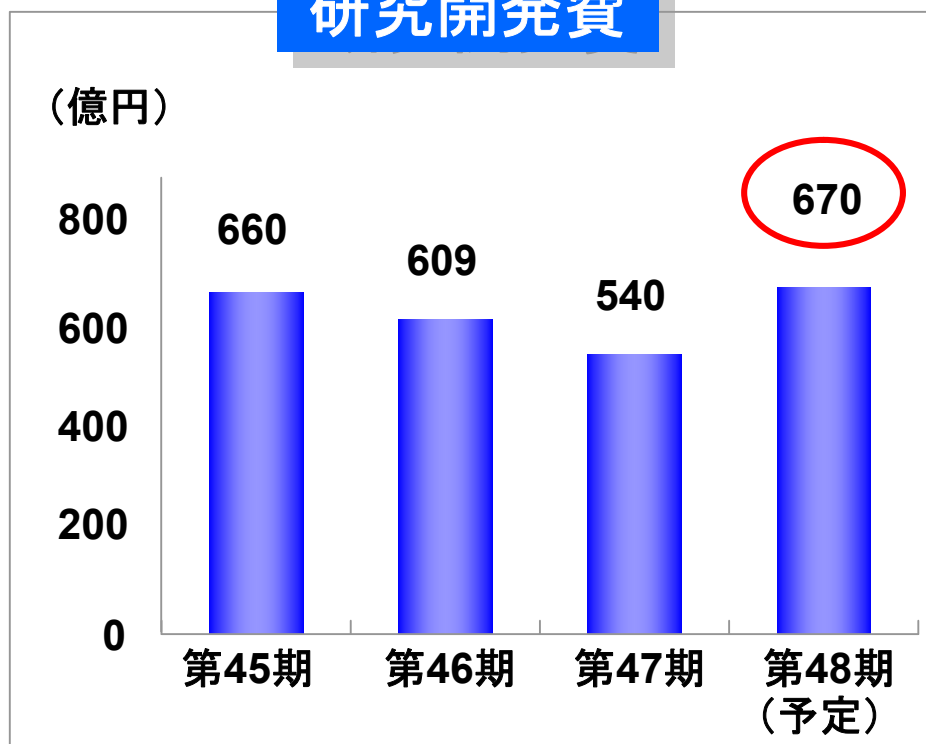
▶ 太陽電池

価格優位性により、単結晶Si系や化合物系が好調
薄膜シリコン系は、中・長期的での成長を期待

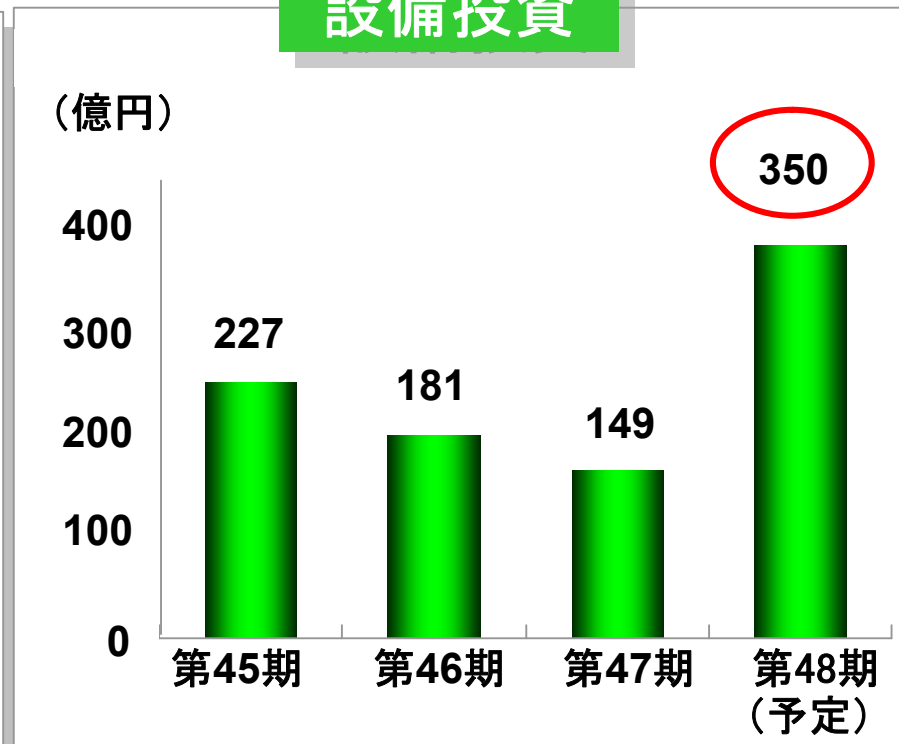
■ 第48期業績見通し

研究開発費・設備投資計画

研究開発費



設備投資



第48期の研究開発費は過去最高水準



■ 第48期業績見通し

第48期 連結業績見通し

(億円)

	上期	下期	通期	前期比
売上高	3,150	3,450	6,600	+58%
SPE	2,400	2,610	5,010	+91%
FPD/PVE	320	370	690	-3%
EC/CN	430	470	900	+7%
営業利益	330 (10.5)	460 (13.3)	790 (12.0)	-
経常利益	340 (10.8)	460 (13.3)	800 (12.1)	32倍
当期純利益	220 (7.0)	330 (9.6)	550 (8.3)	-

(注) SPE: 半導体製造装置, FPD/PVE: フラットパネルディスプレイ及び太陽電池製造装置
EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク ()内は利益率,単位%



■ 第48期業績見通し

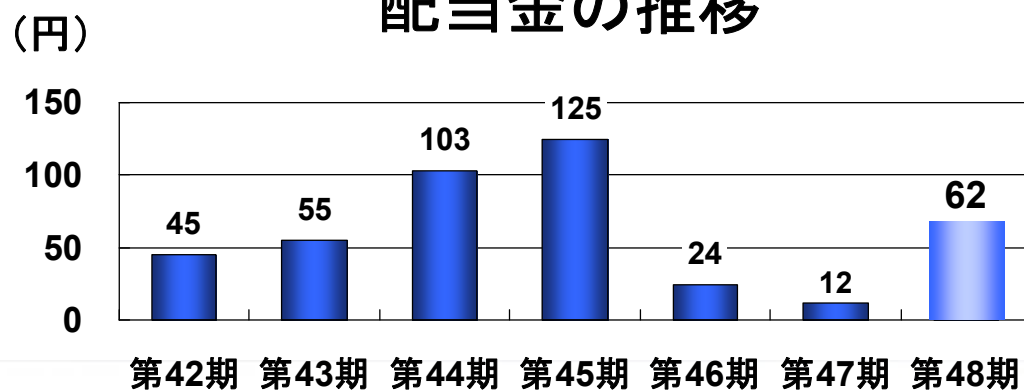
第48期の配当予想

1株当たり配当金

	中間	期末	年間
第47期実績	4 円	8 円	12 円
第48期予想	25 円	37 円	62 円

配当総額	連結 配当性向
21 億円	- %
110 億円	20 %

配当金の推移



中期成長に向けて



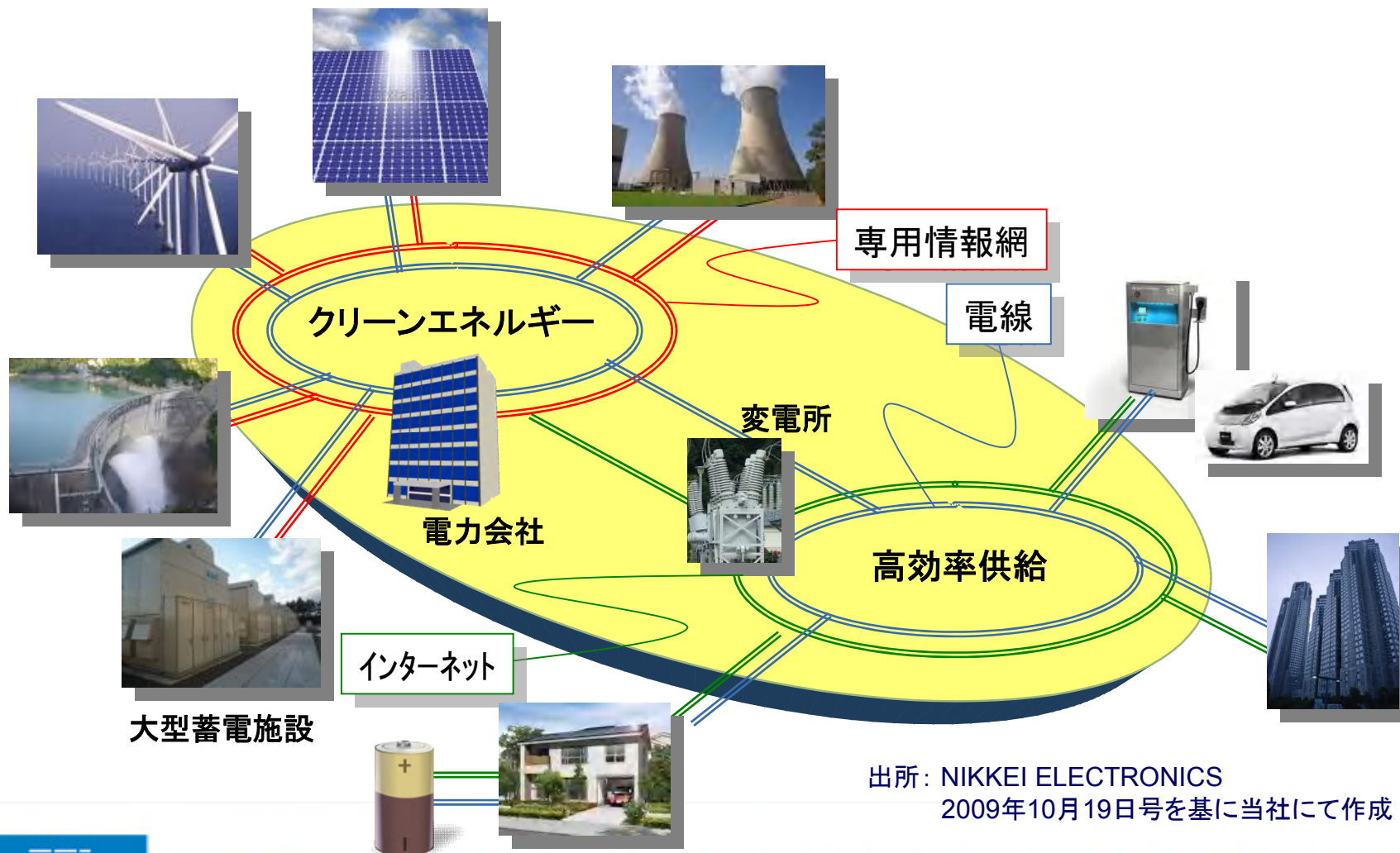
■ 中期成長に向けて

高度情報ネットワーク社会



■ 中期成長に向けて

クリーン & 高効率エネルギー供給システム

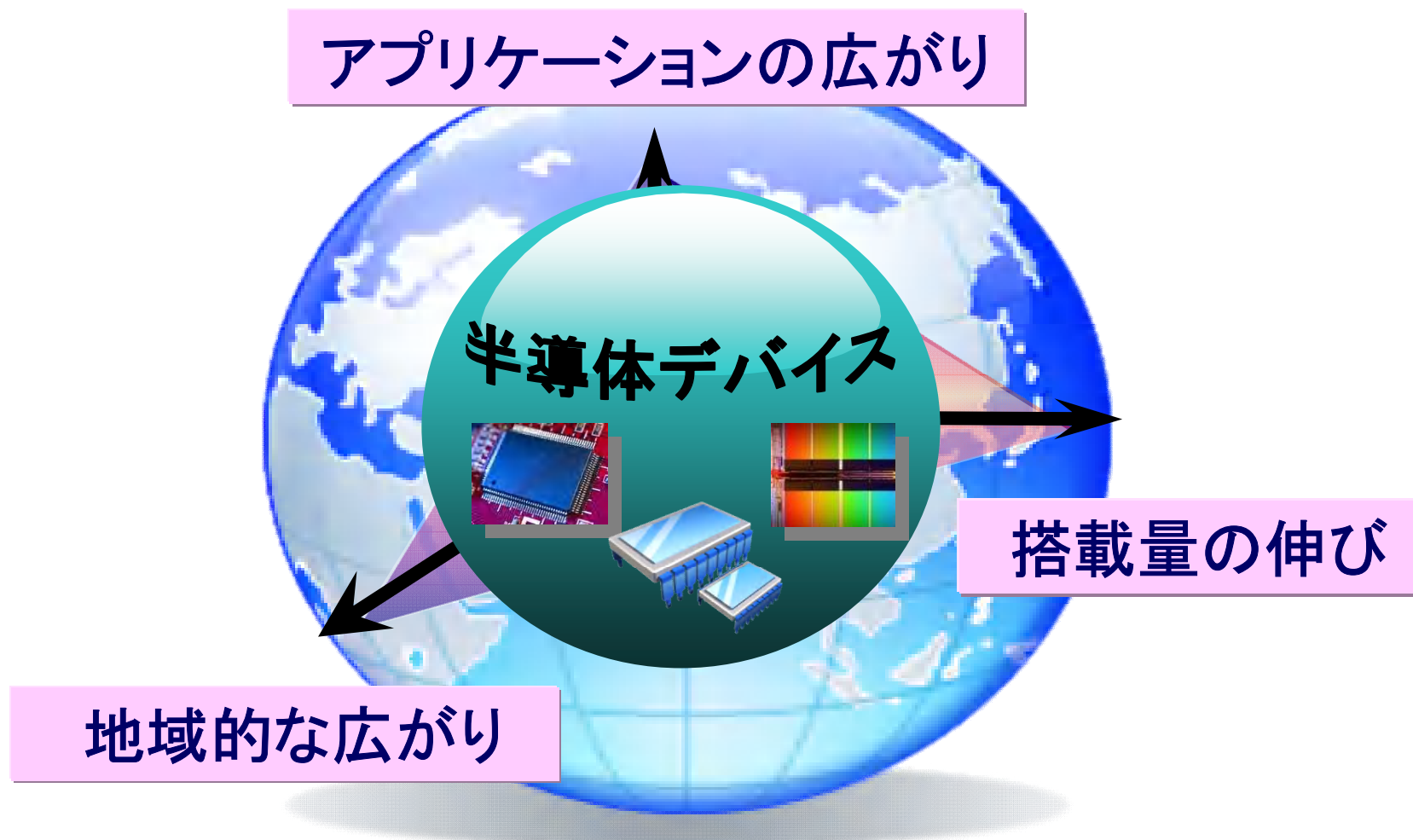


■ 中期成長に向けて

あらゆる生活の場面に行き渡る電子機器



■ 中期成長に向けて



半導体市場は 今まさに3極で急拡大



■ 中期成長に向けて

電子機器関連産業 市場構造 (2010年)



出所: Gartner, 2010年3月 を基に概算値当社作成



基本理念

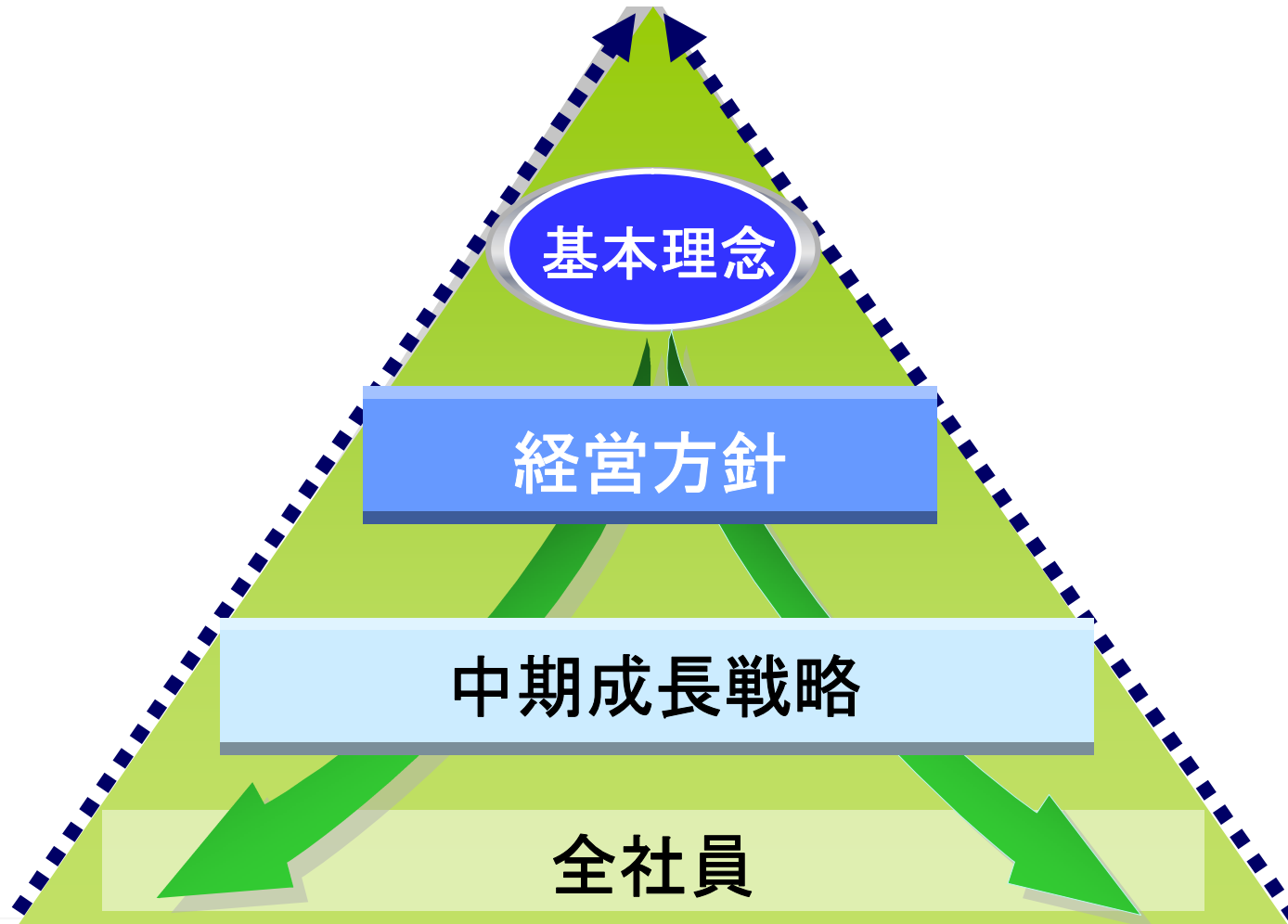
人々の健全で質の高い生活を実現する為に
先端分野に於けるトップサプライヤーとして
価値の高い技術・サービスを世界に提供

夢のある社会の構築、環境問題の対応に
一層のリーダーシップを発揮

使命感を社員全員と共有し
いきいきと輝き 夢と活力に満ちた会社

■ 中期成長に向けて

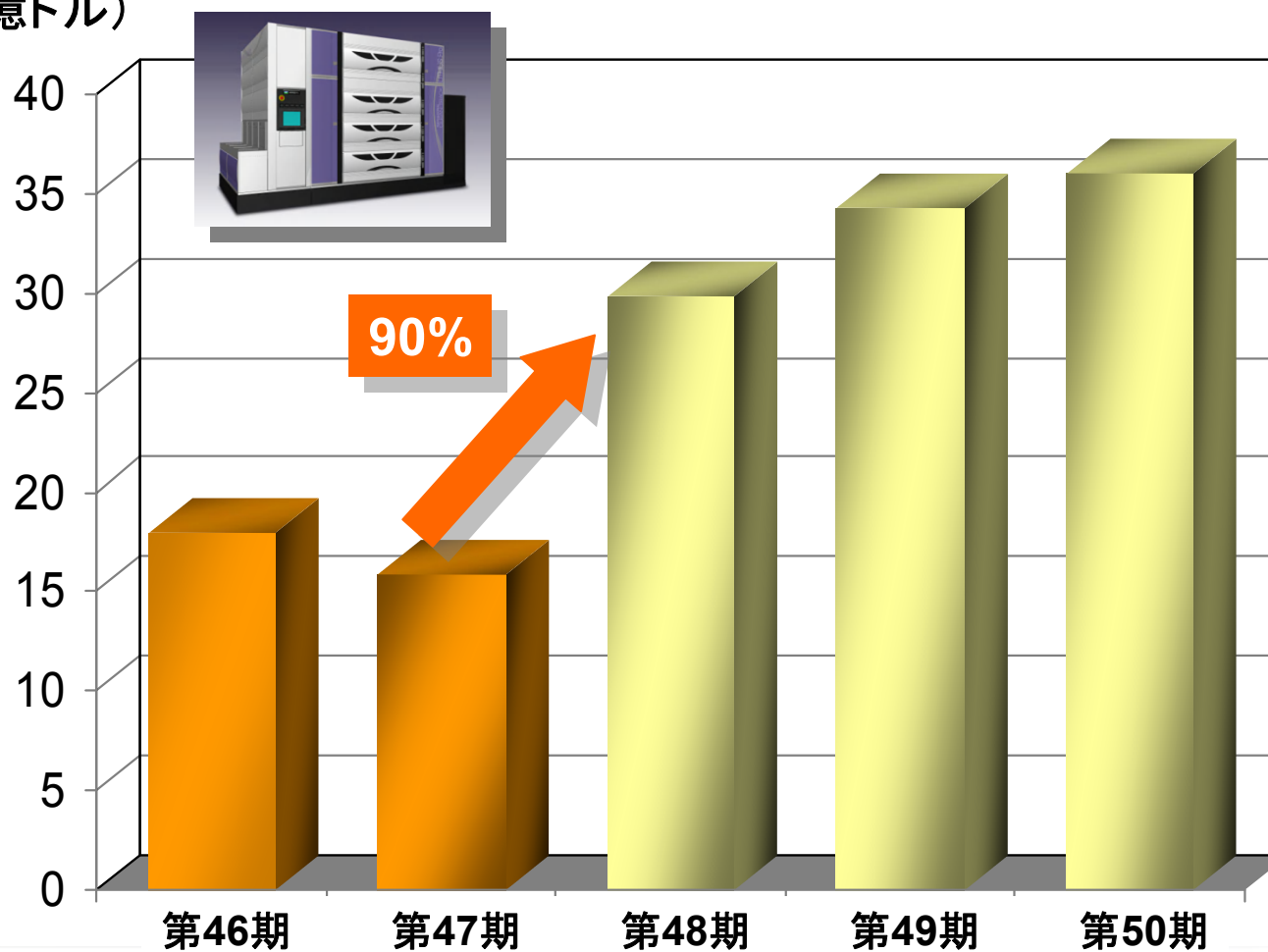
夢と活力に満ちた会社作り



■ 中期成長に向けて

半導体製造装置(前工程)市場

(10億ドル)




出所：当社推定値



■ 中期成長に向けて

半導体製造装置事業の状況と方針

第47期 製品シェア

 当社シェア

コータ/デベロッパ

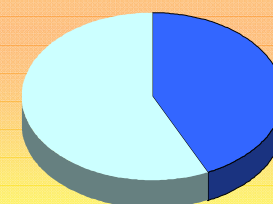
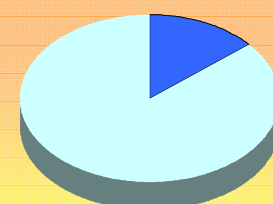
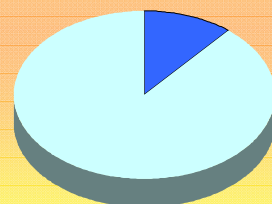
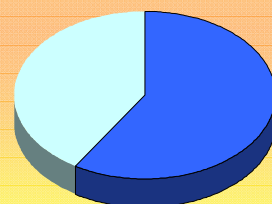
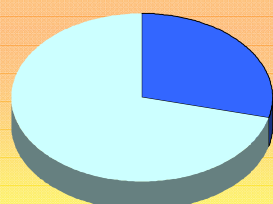
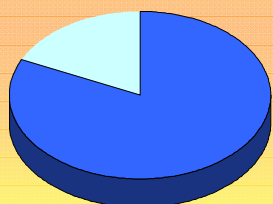
エッチャー

熱処理成膜

枚葉CVD

洗浄

プローバ



シェア：当社推定

ポリエッチ市場への参入

枚葉式洗浄でのシェア拡大

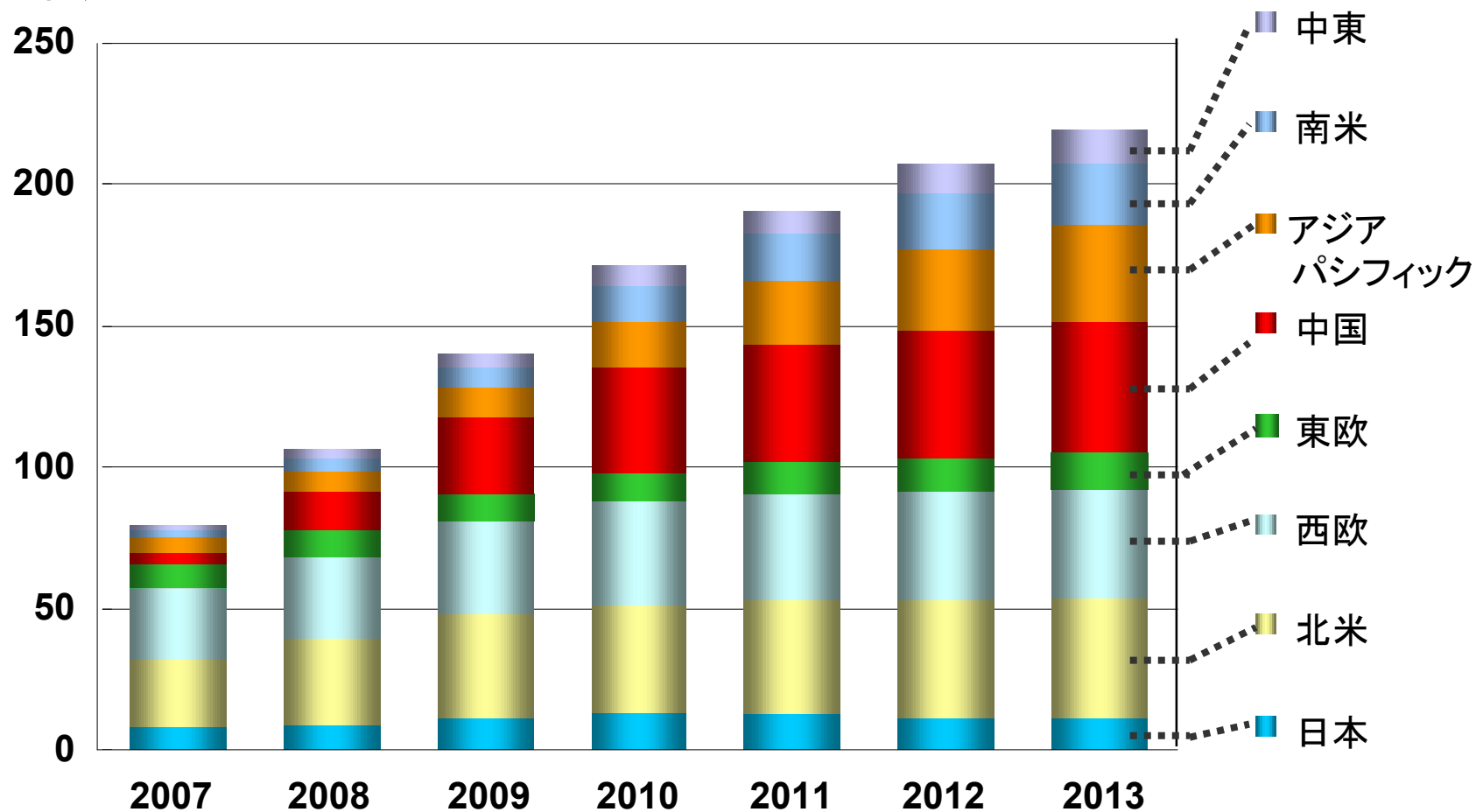
特に エッチング及び洗浄装置に注力



■ 中期成長に向けて

液晶TV 地域別需要予測(台数)

(百万台)

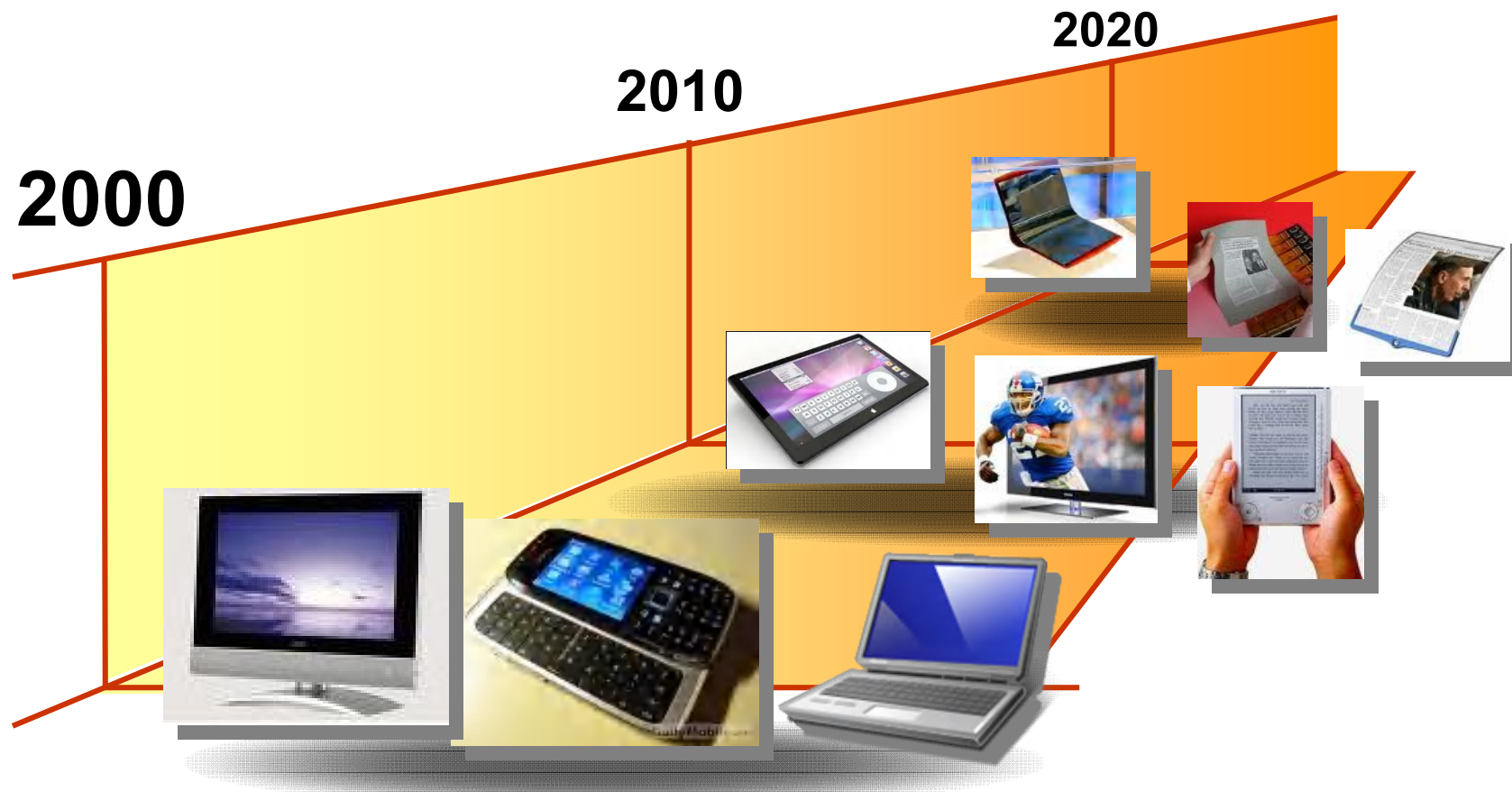


出所: 18th Display Search Forum (2010年1月末開催)資料より



■ 中期成長に向けて

薄型ディスプレイの技術革新

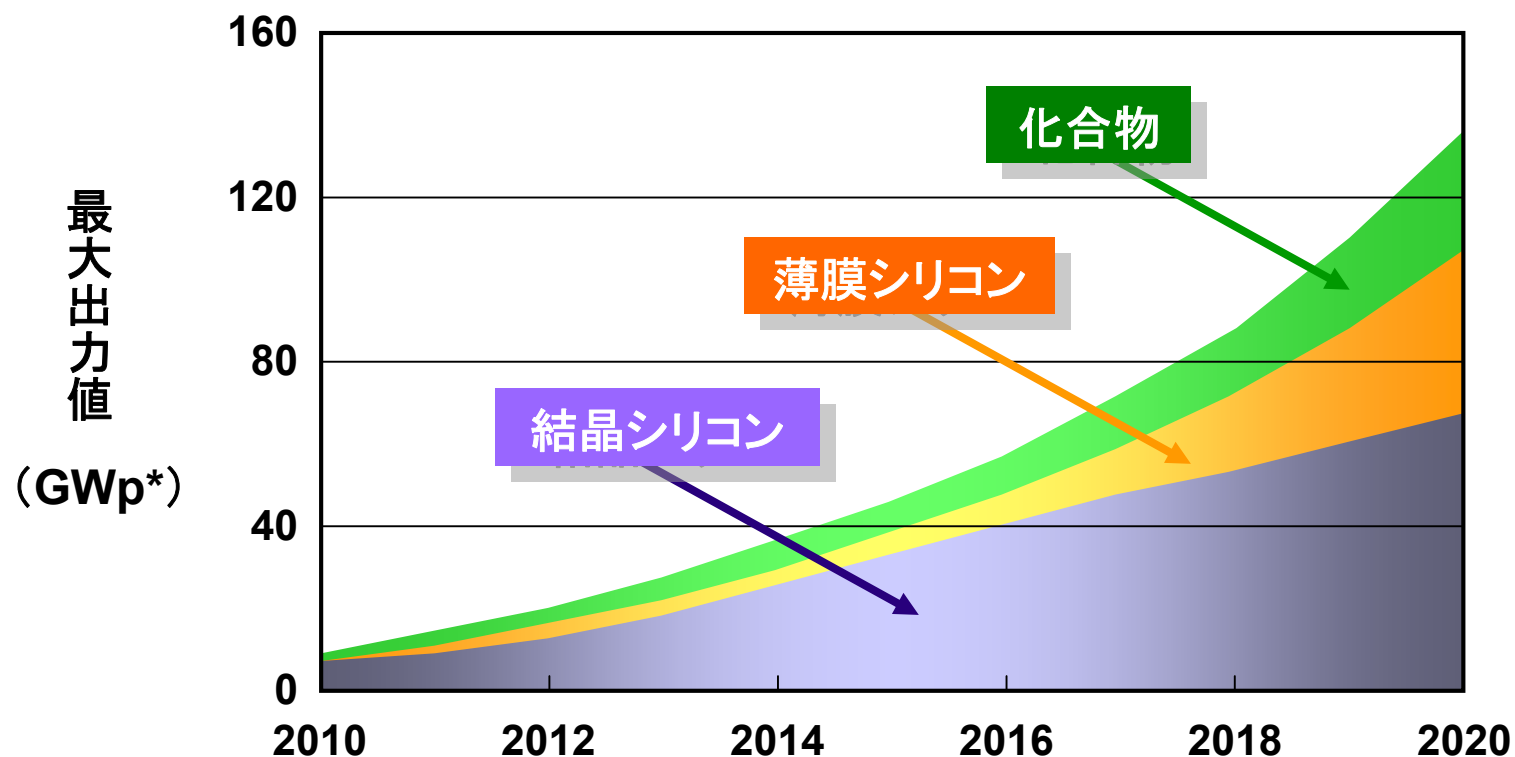


次世代技術開発の加速



■ 中期成長に向けて

太陽電池市場予測 (2010-2020)



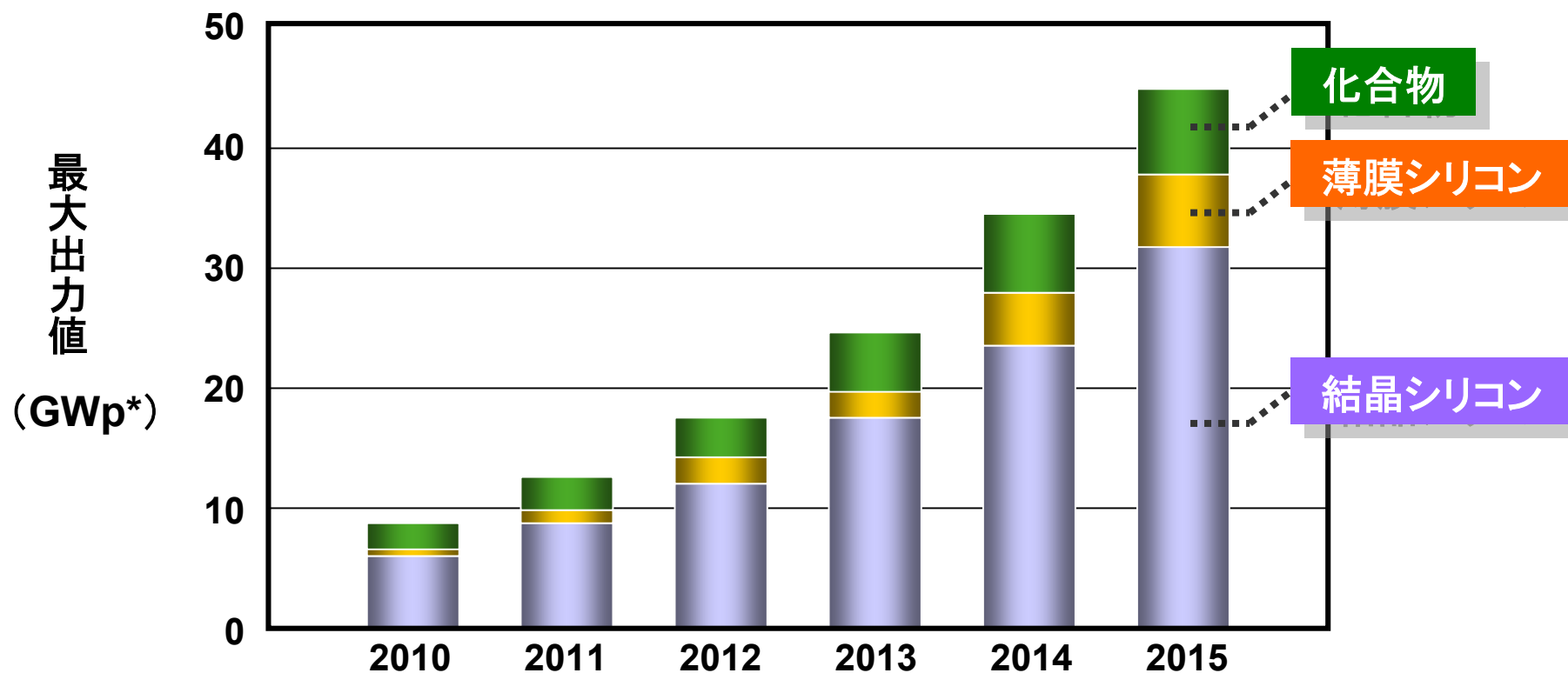
GWp (ギガワット・ピーク)は最大出力値の単位 原子炉1基の通常出力値は約1GW

出所: EPIA (European Photovoltaic Industry Association) 発表に基づく 当社予測- 2010年5月



■ 中期成長に向けて

太陽電池市場予測 (2010-2015)



GWp (ギガワット・ピーク)は最大出力値の単位 原子炉1基の通常出力値は約1GW

出所: EPIA (European Photovoltaic Industry Association) 発表に基づく 当社予測- 2010年5月



■ 中期成長に向けて

技術で環境問題に取り組む



当社装置の省エネルギー化を促進

省電力・省薬液などで当社装置の排出するCO2を削減

省電力・高効率デバイスを作る製造装置の提供

パワー半導体用SiCエピ膜成長装置
有機EL製造装置

クリーンエネルギー関連の製造装置の提供

太陽電池製造装置

当社工場・オフィスにおける環境配慮の促進

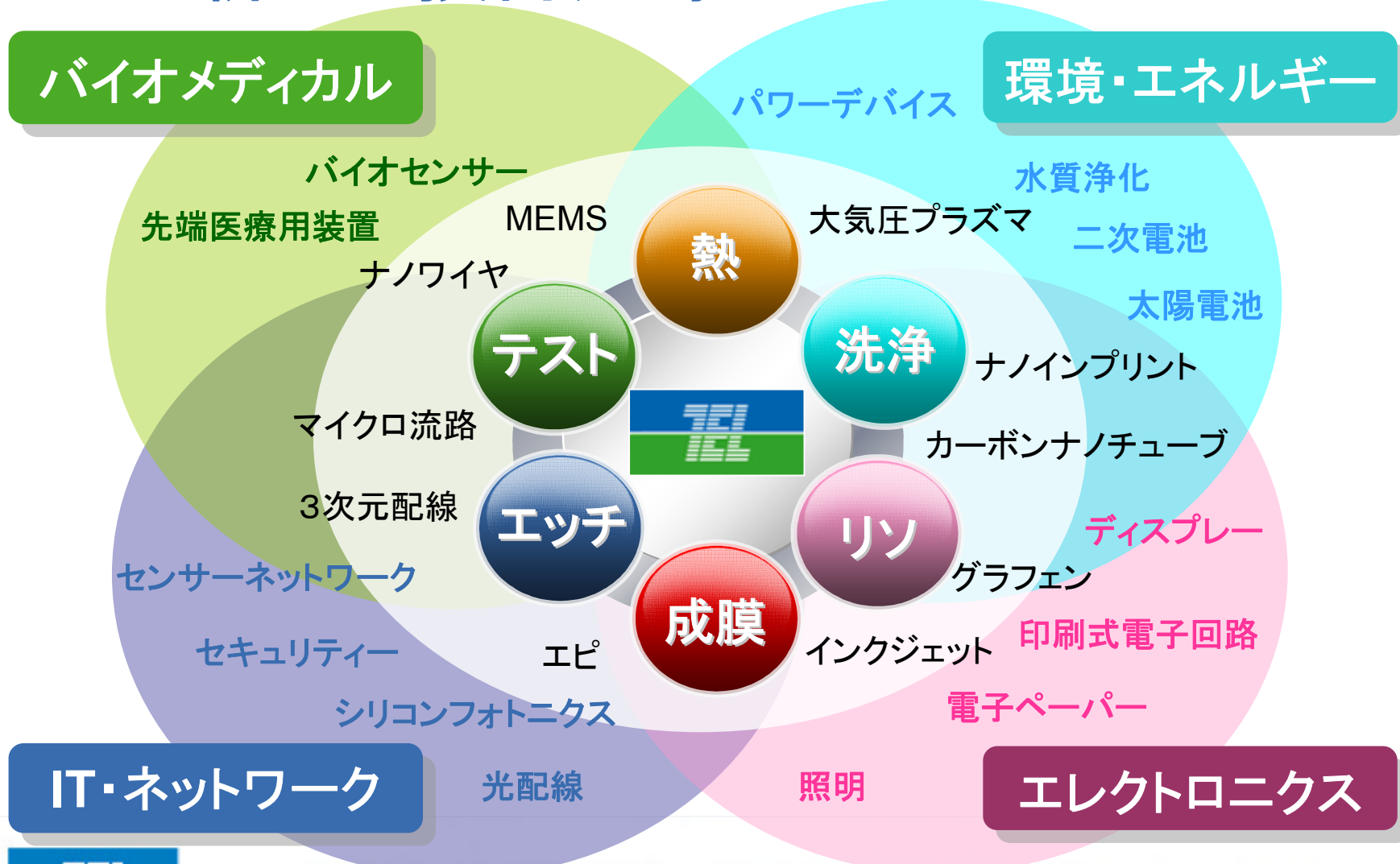
工場・物流等におけるエネルギー使用量の削減

2007年比で2015年に環境負荷半減



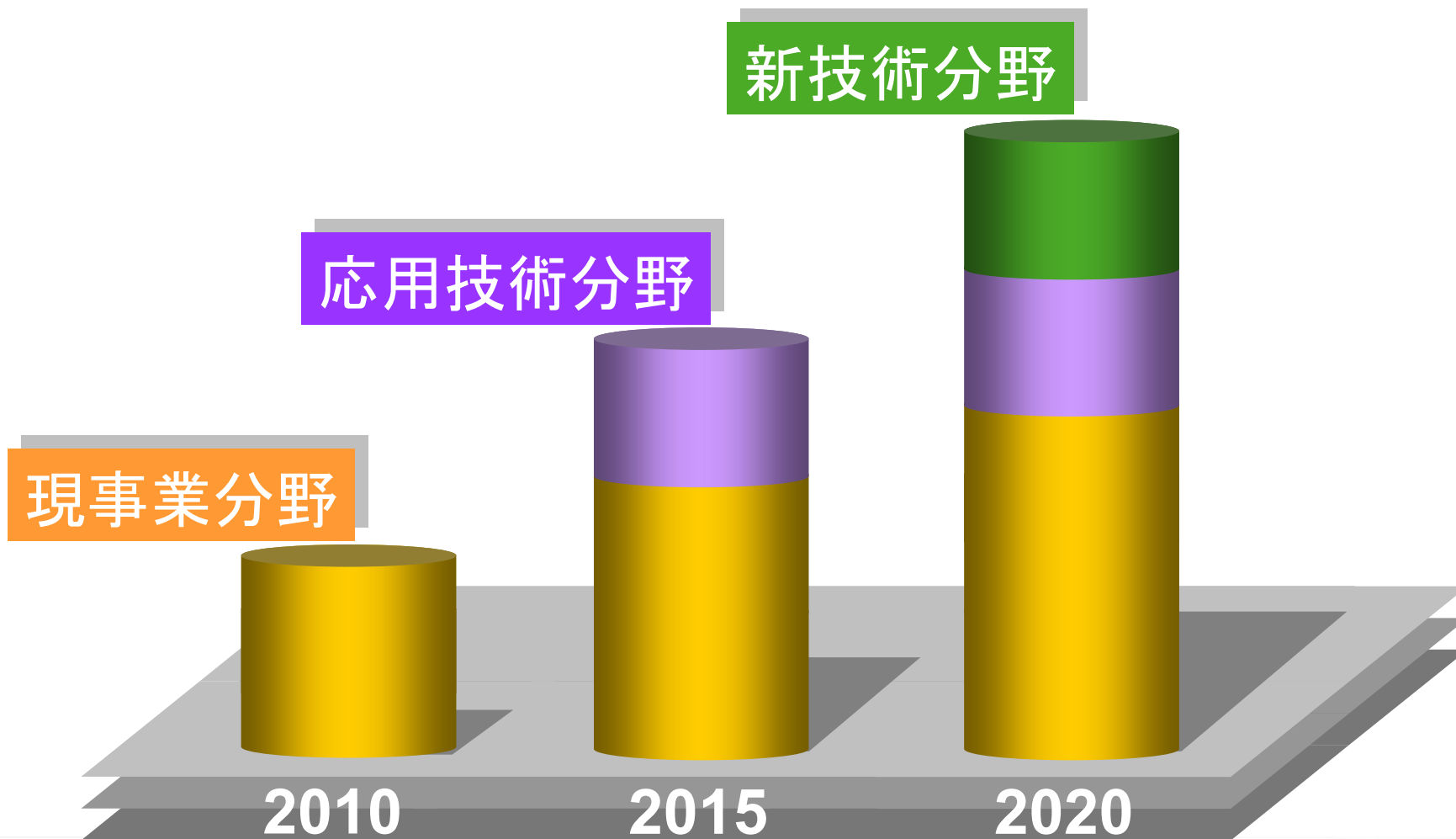
■ 中期成長に向けて

新たな技術分野へのチャレンジ

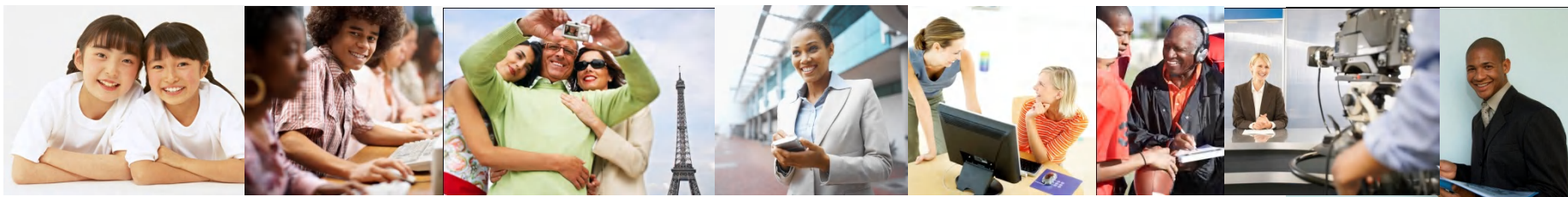


■ 中期成長に向けて

東京エレクトロンの今後10年



私たちの技術が世界を支え、未来を創ります





< 決議事項 >

1. 取締役 1 2 名選任の件
2. 監査役 1 名選任の件

第1号議案

取締役12名選任の件



第1号議案

1. 東 哲郎(昭和24年8月28日生)

略 歴		当社における地位及び担当
昭和52年 4月	当社入社	代表取締役会長
平成 2年12月	当社取締役	重要な兼職の状況 ・Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc. 取締役会長 ・(社)日本半導体製造装置協会会長
平成 6年 4月	当社常務取締役	
平成 8年 6月	当社取締役社長	
平成15年 6月	当社取締役会長(現在に至る)	
		所有する当社の株式数
		38, 128株



第1号議案

2. 常石 哲男(昭和27年11月24日生)

略 歴		当社における地位及び担当
昭和51年 4月	当社入社	取締役副会長 法務、知的財産、広報/IR、 海外顧客担当
平成 4年 6月	当社取締役	
平成 8年 6月	当社専務取締役	
平成15年 6月	当社取締役副会長(現在に至る)	
		重要な兼職の状況
		・Tokyo Electron (Shanghai) Ltd. 取締役会長 ・Tokyo Electron (Shanghai) Logistic Center Ltd. 取締役会長 ・Media Lario International S.A. 社外取締役
		所有する当社の株式数
		6, 358株



第1号議案

3. 佐藤 潔(昭和31年4月2日生)

略 歴		当社における地位及び担当
昭和54年 4月	当社入社	取締役副会長 海外グループ会社、IT、 EHS、グローバル調達、 FPD/PVE中国顧客担当
平成13年12月	当社クリーントラックBUGM	
平成15年 4月	当社社長付執行役員	
平成15年 6月	当社取締役社長	
平成21年 4月	当社取締役副会長(現在に至る)	
平成22年 4月	東京エレクトロンBP(株)取締役会長(現在に至る)	
		重要な兼職の状況
		東京エレクトロンBP(株) 取締役会長
		所有する当社の株式数
		3,000株

※BUGM=ビジネス ユニット ジェネラルマネージャー



第1号議案

4. 竹中 博司(昭和36年2月5日生)

略 歴		当社における地位及び担当
昭和59年 4月	当社入社	代表取締役社長
平成14年 4月	当社枚葉成膜BUGM	重要な兼職の状況
平成15年 4月	当社執行役員	
平成17年 4月	当社サーマルプロセスシステムBUGM	・Tokyo Electron America, Inc. 取締役会長
平成18年 4月	当社SPE-3事業部 副事業部長	・Tokyo Electron Europe Ltd. 取締役会長
平成19年 6月	当社取締役	所有する当社の株式数
平成21年 4月	当社取締役社長(現在に至る)	

※BUGM=ビジネス ユニット ジェネラルマネージャー



第1号議案

5. 久保寺 正男(昭和24年6月21日生)

略 歴		当社における地位及び担当
昭和54年 1月	当社入社	取締役
平成 6年 4月	テル・エンジニアリング(株)取締役	重要な兼職の状況
平成 7年 7月	東京エレクトロン山梨(株)常務取締役	
平成10年 4月	東京エレクトロン宮城(株)取締役社長	東京エレクトロンAT(株) 取締役会長
平成13年 4月	東京エレクトロンAT(株)専務取締役	
平成15年 4月	同社取締役会長	
平成16年 6月	当社取締役(現在に至る)	所有する当社の株式数
平成19年 6月	東京エレクトロンAT(株)取締役会長(現在に至る)	2, 552株



第1号議案

6. 岩津 春生(昭和25年3月20日生)

略 歴		当社における地位及び担当
昭和59年11月	当社入社	取締役
平成 5年 4月	東京エレクトロン九州(株)取締役	重要な兼職の状況 東京エレクトロン九州(株) 取締役会長
平成10年 4月	同社常務取締役	
平成12年 1月	当社洗浄システムBUGM	
平成15年 4月	東京エレクトロン九州(株)取締役社長	
平成17年 6月	当社取締役	
平成18年10月	東京エレクトロン九州(株)取締役会長(現在に至る)	
平成19年 6月	当社取締役副社長	
平成21年 4月	当社取締役(現在に至る)	所有する当社の株式数 6,000株

※BUGM=ビジネス ユニット ジェネラルマネージャー



第1号議案

7. 北山 博文(昭和29年3月28日生)

略 歴	
昭和58年12月	テル・サームコ(株)入社
平成 7年 7月	東京エレクトロン東北(株)取締役
平成11年 3月	東京エレクトロン山梨(株)取締役
平成15年 4月	東京エレクトロンAT(株)常務執行役員
平成17年 2月	同社取締役社長
平成18年 4月	東京エレクトロン東北(株)取締役社長 当社執行役員
平成19年 6月	当社取締役(現在に至る)
平成20年10月	東京エレクトロン東北(株)取締役会長(現在に至る)
平成21年 4月	当社専務執行役員(現在に至る) 東京エレクトロンPS(株)取締役会長(現在に至る)
平成22年 4月	東京エレクトロン技術研究所(株)取締役会長 (現在に至る)

当社における地位及び担当
取締役 専務執行役員

重要な兼職の状況
<ul style="list-style-type: none"> 東京エレクトロン東北(株) 取締役会長 東京エレクトロン技術研究所(株) 取締役会長 東京エレクトロンPS(株) 取締役会長 Tokyo Electron Korea Solution Ltd. 取締役会長

所有する当社の株式数
2,600株



第1号議案

8. 鷺野 憲治(昭和36年6月7日生)

略 歴		当社における地位及び担当
昭和59年 4月	当社入社	取締役 専務執行役員
平成15年 4月	当社執行役員、洗浄システムBUGM	重要な兼職の状況 ・Tokyo Electron Massachusetts, LLC 取締役会長 ・TEL Venture Capital, Inc. 取締役会長 ・TEL Epion Inc. 取締役会長
平成17年 4月	当社枚葉成膜BUGM	
平成18年 4月	当社SPE-2事業部 副事業部長	
平成19年 6月	当社取締役(現在に至る)	
平成21年 4月	当社専務執行役員(現在に至る)	
		所有する当社の株式数
		2,000株

※BUGM=ビジネス ユニット ジェネラルマネージャー



第1号議案

9. 伊東 晃(昭和36年8月30日生)

略 歴		当社における地位及び担当
昭和59年 4月	当社入社	取締役 専務執行役員
平成15年 4月	当社執行役員、クライアントラックBUGM	重要な兼職の状況
平成18年 4月	当社SPE-1事業部 副事業部長	Timbre Technologies, Inc. 取締役会長
平成19年 6月	当社取締役(現在に至る)	所有する当社の株式数
平成21年 4月	当社専務執行役員(現在に至る)	2, 100株

※BUGM=ビジネス ユニット ジェネラルマネージャー



第1号議案

10. 中村 隆(昭和29年10月6日生)

略 歴		当社における地位及び担当
昭和54年 4月	当社入社	取締役 常務執行役員 倫理担当 内部統制担当
平成 9年10月	東京エレクトロン山梨(株)取締役	
平成13年 4月	当社コーポレート・シニア・スタッフ	
平成15年 4月	東京エレクトロン ロジスティクス(株)取締役社長	
平成15年10月	東京エレクトロンBP(株)取締役社長	
平成16年10月	東京エレクトロン九州(株)専務執行役員	
平成20年 4月	東京エレクトロンAT(株)専務執行役員	
平成21年 4月	当社常務執行役員(現在に至る)	
平成21年 6月	当社取締役(現在に至る)	
		所有する当社の株式数
		1,300株



第1号議案

11. 井上 弘(昭和15年1月5日生)

略 歴	
昭和38年 4月	(株)東京放送入社
平成 5年 6月	同社取締役
平成 8年 6月	同社常務取締役
平成 9年 6月	同社専務取締役
平成13年 6月	同社取締役副社長
平成14年 6月	同社取締役社長
平成18年 6月	当社取締役(現在に至る)
平成21年 4月	(株)東京放送ホールディングス取締役会長(現在に至る)

当社における地位及び担当

取締役

重要な兼職の状況

- ・(株)東京放送ホールディングス 取締役会長
- ・(株)TBSテレビ 取締役会長
- ・(株)毎日放送 社外取締役
- ・アール・ケー・ビー毎日放送(株) 社外監査役
- ・(株)青森テレビ 社外取締役
- ・(株)アビシー岩手放送 社外取締役
- ・(株)南日本放送 社外取締役
- ・(株)ビデオリサーチ 社外取締役
- ・(株)中国放送 社外取締役

所有する当社の株式数

0株

■ 会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります



第1号議案

12. 坂根 正弘(昭和16年1月7日生)

略 歴	
昭和38年 4月	(株)小松製作所入社
平成元年 6月	同社取締役
平成 6年 6月	同社常務取締役
平成 9年 6月	同社専務取締役
平成11年 6月	同社取締役副社長
平成13年 6月	同社取締役社長
平成15年 6月	同社取締役社長兼CEO
平成19年 6月	同社取締役会長(現在に至る)
平成20年 6月	当社取締役(現在に至る)

当社における地位及び担当
取締役

重要な兼職の状況
・(株)小松製作所 取締役会長 ・野村證券(株) 社外取締役 ・野村ホールディングス(株) 社外取締役

所有する当社の株式数
0株

■ 会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります



第2号議案

監査役1名選任の件



第2号議案

1. 原 護(昭和21年8月14日生)

略 歴		当社における地位及び担当
昭和45年 4月	当社入社	取締役
平成元年12月	当社取締役	重要な兼職の状況 シミック(株) 社外取締役
平成 8年 4月	東京エレクトロン東北(株)専務取締役	
平成 8年 6月	当社取締役退任	
平成11年 3月	東京エレクトロンEE(株)取締役社長	
平成13年 7月	東京エレクトロン デバイス(株)取締役会長	
平成14年 2月	東京エレクトロンAT(株)取締役社長	所有する当社の株式数
平成14年 6月	当社取締役(現在に至る)	8,900株





**私たちの技術が
世界を支え、未来を創ります。**



用語集

半導体デバイス	半導体材料(シリコンなど)の特性を利用した電子部品。代表的なものにDRAM(メモリー)、CPU(中央演算処理)がある	
SPE	Semiconductor Production Equipment	半導体製造装置
FPD	Flat Panel Display Production Equipment	フラットパネルディスプレイ(液晶)製造装置
PVE	Photovoltaic Production Equipment	太陽電池製造装置
プラズマ技術	電離した気体(プラズマ)の特性を応用し半導体製造工程に利用する技術	
RLSA	Radial Line Slot Antenna	高密度プラズマ技術の一種
	衛星放送用に開発されたアンテナ技術を、半導体製造の主工程であるポリエッチ(多結晶シリコン膜の除去)工程やCVD工程に応用したもの。その特徴として低ダメージ(製造工程での物理的、化学的ダメージが低い)、高選択比(加工材料以外に影響を及ぼさない)が挙げられる	
フィールドエンジニアリング事業	装置販売後の製品本体の保守、移設、改造や消耗品販売等のアフターサービス事業	
前工程	半導体製造工程のうち、シリコンウエハー上に回路を形成する工程。リソ(パターン転写)、コーター/デベロッパ(塗布現像)、熱処理成膜、枚葉CVD、洗浄、プローブ(電気的検査)などの工程により構成されている	
リソ	リソグラフィー(Lithography)の略称。シリコンウエハーなどにIC回路のパターンを描画する技術	
太陽電池	太陽電池として現在複数の方式が開発、生産されており、単結晶シリコンを利用する結晶シリコン方式、薄膜シリコンを重ね合わせる薄膜シリコン方式、そして金属ならびに有機化合物を利用するものがある	
パワー半導体	通常の半導体デバイスよりも高耐圧化、大電流化、高周波化されているのが特徴。近年シリコン(Si)に代わる新たな材料として、炭化珪素(SiC)が注目を集めている	
バイオメディカル	Biomedical(生物医学)	細胞、遺伝子、DNAレベルでの研究を行う医学分野

